

LabSpin6/8

Установка нанесения/проявления фоторезиста с ручным управлением



Вам нужны	Решения LABSPIN
Широкий выбор процессов	+ Нанесение с помощью центрифуги + Проявление поливом + Сушка
Гибкость	+ Регулируемое положение подачи фоторезиста позволяет добиться нанесения по центру и по краям пластины + Проявление поливом благодаря колебаниям держателя уменьшает время проявления + Возможность удаления застывшего фоторезиста с краев пластины
Простота эксплуатации	+ ПО с сенсорной панелью обеспечивает простую и комфортную эксплуатацию + Съемная чаша для быстрой смены процессов без перекрестного загрязнения
Надежность и безопасность	+ Непосредственно связанный двигатель с полым валом с вакуумным стеклом для защиты от брызг + Сливная бутылка в передней панели для облегчения доступа и мониторинга уровня заполнения

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ И ПРОЦЕССОВ ПРОЯВЛЕНИЯ

Платформа LabSpin SUSS MicroTec's представляет собой последнее поколение систем нанесения/проявления фоторезиста с ручным управлением, разработанных специально для лабораторий и НИИ. Система LabSpin предназначена для работы с целым рядом химических веществ и обеспечивает однородные, точные и воспроизводимые результаты нанесения благодаря улучшенному дизайну рабочей камеры.

Системы LabSpin доступны в двух версиях для работы с пластинами до 150 мм или 200 мм в виде настольной системы и в виде модуля, встраиваемого в стол для жидкостной химической обработки. Они характеризуются надежным понятным дизайном, который обеспечивает комфортную и стабильную эксплуатацию. Сочетание технических деталей, например стеклянная крышка для максимальной химической устойчивости, съемная чаша для простоты очистки и особый дизайн камеры «без брызг», делает эту серию уникальной.

Дизайн всего устройства, включая конструкцию рабочей камеры и итоговое качество нанесения, основаны на проверенной опытом компании SUSS MicroTec технологии.

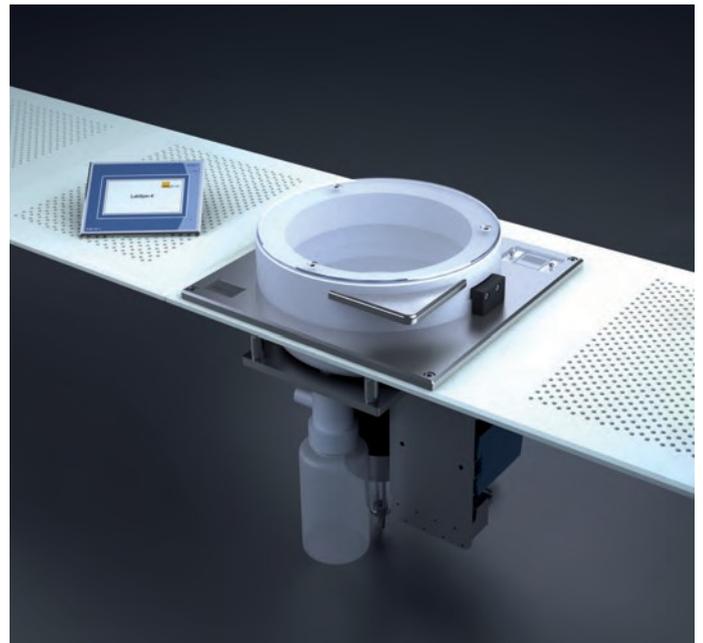
Установки нанесения резиста LabSpin могут обрабатывать целый ряд подложек, включая круглые и квадратные, а также детали благодаря стандартным и изготовленным по индивидуальному заказу держателям. Небольшое основание требует минимального свободного пространства.

Необходимый вакуум для держателя создается внутри установки с помощью сопла Вентури и подаваемого сжатого воздуха, поэтому необходимость в дополнительном вакуумном насосе отсутствует (оператор может изменить конфигурацию для внешней подачи вакуума).

Независимо от выбранной конфигурации в основе каждой системы LabSpin лежит признанный опыт и качество продукции компании SUSS.

Широкий выбор опций для целого ряда применений:

- + нанесение фоторезиста, опционно с:
 - шприцем или автоматической системой нанесения
 - системой удаления наплывов резиста с края пластин
- + нанесение покрытия на кромки
- + проявление поливом.



LabSpin6 BM (встраиваемая система) для установки в стол для жидкостной химической обработки.

Установка нанесения/проявления резиста

Доступные опции

Крышка для дополнительных функций

Системы LabSpin можно оборудовать крышкой для изменения расположения сопла для нанесения фоторезиста, что позволит проводить нанесение по центру пластины, наносить покрытие на кромки и удалять наплывы материала с краев пластины. Для процессов проявления в крышку можно также вмонтировать систему нанесения проявителя и линию продувки азотом для сушки резиста.

Шприцевая система нанесения

Опция шприцевого нанесения под давлением является мощным инструментом для процессов с небольшим количеством фоторезиста или в которых требуется частая смена материала. Такая система позволяет использовать дорогостоящие материалы более экономно и эффективно.

Полностью автоматическая система нанесения

Полностью автоматическая система нанесения является прекрасным решением для покупателей, которым необходимо обрабатывать несколько пластин на устройстве с ручным управлением. Полностью автоматическая система нанесения устанавливается прямо на бутылку с фоторезистом. Высокая частота, а также оптимизированный объем нанесения позволяют уменьшить до минимума расход материала и сократить эксплуатационные расходы.

Нанесение покрытия на кромки пластины

Система LabSpin позволяет наносить покрытие на кромки пластины для лучшей защиты на всех шагах процесса. Нанесение покрытия на кромки возможно для пластин диаметром от 2 дюймов до 150 мм на системах LabSpin6 и для пластин от 2 дюймов до 200 мм на системе LabSpin8.

Удаление наплывов резиста с краев пластины (EBR)

Системы серии LabSpin позволяют удалять наплывы резиста с пластин диаметром от 2 дюймов до 150 мм или с пластин диаметром 200 мм при наличии регулируемого сопла для удаления наплывов. Опция EBR-распыления включает в себя полностью автоматическую систему нанесения для подачи растворителя.

Система нанесения проявителя

Система LabSpin может быть также настроена для процессов проявления наливом. Опция нанесения проявителя подключена напрямую к крышке, в качестве системы нанесения проявителя используется сосуд избыточного давления. Благодаря колебательным движениям держателя платформа LabSpin обеспечивает равномерные результаты обработки при более коротком времени процесса.

Сушка азотом

Данная опция позволяет высушить пластину после проявления и промывки деионизированной водой. Цифровой дисплей перед устройством позволяет контролировать поток азота.

Ножной выключатель

Для удобства запуска процесса в конфигурацию можно добавить ножной выключатель.

Технические данные

Конфигурации	
LabSpin6	Подложки до 150 мм круглые или 4 дюйма квадратные
LabSpin8	Подложки до 200 мм круглые или 6 дюймов квадратные
Версии	
Отдельная система	Настольная версия (ТТ)
Для интеграции в стол	Версия для встраивания (ВМ)
Контроллер	
ГИП	Сенсорная панель с цветным экраном
Макс. кол-во рецептов	200
Макс. кол-во шагов процесса	40
Программ. время шага	1 - 999 с
Двигатель	Бесщеточный EC-мотор с полым валом и защитным стеклом
Макс. скорость вращения	8 000 об/мин +/- 1 об/мин (с держателем 200 мм)
Макс. ускорение	4 000 об/мин/с
Безопасность	
Цифровой вакуумметр	да
Автом. контроль вакуума	да
Контроль закрытой крышки	да
Требования	
Питание	4.6А / 2.5А (115В / 230В)
Сжатый воздух	5 - 6 бар
Вакуум	мин. -0.7 бар (опц.)
Азот	5 - 6 бар (опц.)
Габариты*	
LabSpin6 ВМ (Ш x Г x В)	320 x 310 x 415 мм ³
LabSpin8 ВМ (Ш x Г x В)	350 x 340 x 415 мм ³
Контроллер (Ш x Г x В)	160 x 120 x 67 мм ³
LabSpin6 ТТ (Ш x Г x В)	320 x 425 x 420 мм ³
LabSpin8 ТТ (Ш x Г x В)	350 x 455 x 420 мм ³

* без опций

Данные, конструкция и технические характеристики зависят от индивидуальных условий процесса и могут изменяться в зависимости от конфигураций оборудования. Не все технические характеристики могут быть актуальны одновременно. Изображения, фотографии и технические характеристики, представленные в данной брошюре, не являются юридически обязательными. Компания SUSS MicroTec оставляет за собой право изменять технические характеристики установки без предварительного уведомления.

Посетите наш сайт www.tbs-semi.ru или свяжитесь с нами:

SÜSS MicroTec AG
Phone: +49 89 32007-0
E-Mail: info@suss.com

ООО «ТБС»
Тел./факс: +7 495-287-85-77
E-Mail: infos@tbs-semi.ru